

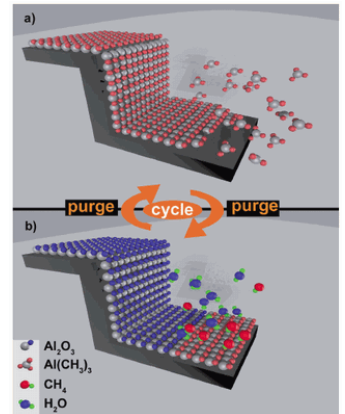
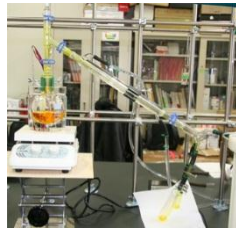
最先端半導体製造プロセスにおける気相成長の役割 ～薄膜作製方法の最新技術動向～

日時：平成24年11月20日（火曜日） 16:00～

会場：農工大・多摩小金井ベンチャーポート1F会議室

受講料：無 料

発表者：気相成長株式会社 代表取締役 町田 英明



今月のテーマは、「最先端半導体製造プロセスにおける気相成長の役割」です。

今日の半導体・太陽電池・LED製品は、薄膜の集合体と言っても過言ではありません。これらの製造メーカーでは、ミクロンからナノオーダーまで、薄膜作製技術を駆使して最先端デバイスを開発・製造しています。薄膜作製方法には、古くはメッキ法から最先端の気相成長法まで多岐に渡ります。

今回は、気相成長技術とはどのようなものか？ 我々の日常でどのような製品に使われているのか？ そして、最先端半導体プロセスの薄膜技術動向について語っていただきます。

ご関心のある方は、是非ご参加をお願いします。また、ご不明な点は下記の宛先へご相談ください。

（注）気相成長法とは、薄膜作製技術の一つです。入居企業である「気相成長株式会社」は、技術名をそのまま社名にしております。気相成長株式会社は半導体プロセスに深く踏み込み、長年の経験とハイレベルな気相成長技術を基に次世代・次々世代の半導体デバイスの開発を支えています。

時間	内 容
16:00～	講演、ディスカッション 発表者：気相成長株式会社 代表取締役 町田 英明
17:20～	名刺交換会・交流会 参加費¥1,000です。ドリンクと、簡単なおつまみを用意してます。 持込大歓迎です！

対象： 興味のある方ならどなたでもご参加頂けます。

申込方法： 下記のMail Address、裏面の申込書をFaxあるいは直接IM室までご連絡下さい。

定員： 30名程度（定員になり次第、締切らせていただきます）

申込： 農工大・多摩小金井ベンチャーポート IM室 大野・古橋・弘田
〒184-0012 小金井市中町2-24-16
TEL：042-382-3855 FAX：042-382-1566
E-mail：info-tatvp@kanto-bi.smrj.go.jp

◆お問い合わせ先

農工大・多摩小金井ベンチャーポート1M室

〒184-0012

東京都小金井市中町2-24-16

TEL: 042-382-3855

FAX: 042-382-1566

info-tatvp@kanto-bi.smrj.go.jp (メールでの参加受付先)

申込書

フリガナ	
氏名	
企業名	
業種	
住所	
TEL	
FAX	
E-mail	@
申込内容	<input type="checkbox"/> 講演会のみ参加 <input type="checkbox"/> 講演会&交流会 両方に参加 <input type="checkbox"/> 交流会のみ参加

アクセス

JR中央線 東小金井駅 徒歩約7分

車でお越しの際は、大学正門にて駐車券を発行してご入構ください。

<http://www.smrj.go.jp/incubation/tama-koganei/access/054465.html>

